AIN 導波路第二高調波発生デバイスのための集光グレーティング結合器

Focusing Grating Coupler for AlN Waveguide Second-Harmonic Generation Device

阪大院工¹, 三重大地域創生戦略企画室², 三重大院工³, 三重大院地域イノベ⁴ ⁰森岡 佳紀¹, 上向井 正裕¹, 上杉 謙次郎², 正直 花奈子³, 三宅 秀人³⁴, 森川 隆哉¹, 藤原 康文¹, 谷川 智之¹, 片山 竜二¹ Osaka Univ.¹, Mie Univ.², ^OY. Morioka¹, M. Uemukai¹, K. Uesugi², K. Shojiki², H. Miyake², T. Morikawa¹, Y. Fujiwara¹, T. Tanikawa¹, and R. Katayama¹ E-mail: morioka.y@qoe.eei.eng.osaka-u.ac.jp

AIN は強い光学非線形性と深紫外光に対する透明性を有し、深紫外波長域の第二高調波発生(SHG) デバイスへ応用可能である。これまでに我々は AIN の極性を反転し積層させた横型擬似位相整合チャ ネル導波路 SHG デバイスを作製し、青色領域における SHG を実証した[1]。しかし、チャネル導波路の 断面は 1.0 × 0.3 µm²程度と微小であり、端面結合によるレーザ光入射は非常に困難である。導波路型グ レーティング結合器(GC)を用いれば、入力結合効率は低下するものの、その開口の大きさ(約 0.2 mm 角)から導波路端面結合に比べ入射ビームの位置合わせが格段に容易となる。本研究では、実用的な 深紫外 SHG デバイス実現の前段階として、AIN 単層チャネル導波路にレーザ光を結合させる集光 GC と テーパ型導波路の設計と作製を行った。

入力 GC とテーパ型導波路およびチャネル導波路 SHG デバイスを集積した構成を Fig.1 に示す。GC に照 射された波長 532 nm の入射波は収束円筒波に波面変 換され、テーパ型導波路を伝搬しながらチャネル導波路 の入射端に集光される。GCの開口を0.20×0.20 mm²と し、集光された導波光のビームウエストがチャネル導波 路における基本導波モード電界振幅の 1/e 全幅に一致 するよう、テーパ型導波路長を0.31 mm とした。相反定 理より、入射光のガウス振幅分布と出力 GC における導 波モード減衰振幅分布の GC 開口内重なり積分 Iを考 えると、入力結合効率 η_{in} は出力結合効率 η_{out} とIの積 となる(Fig. 2)。 厚さ 0.3 µm の AlN プレーナ 導波路にお いて、GC 溝深さ96 nm のとき n_{in}は最大 28%となった。 この値は、導波路端面結合における ηin の最大値 72%と 比べ低いものの、ninが20%まで低下する程度の位置ず れを許容としたとき、GC の導入により位置ずれ許容幅は 0.5 µm から 150 µm まで大きく改善することがわかった。

サファイア基板上にスパッタ法とアニールで成長した AIN 薄膜を用いてデバイスの作製を行った。AIN 薄膜上 に SiO₂ 薄膜を堆積した後、電子ビーム描画により集光 GCパターンを描画した。これを CF4/H2ガスを用いた RIE により SiO₂層に転写し、さらに Cl2ガスを用いた ICP-RIE で AIN に GC を形成した。その後 Ni マスクを用いた 2 度 目の ICP-RIE により AIN をサファイア基板までエッチン グし、テーパ型導波路とチャネル導波路を形成した(Fig. 3)。次に SiO₂ クラッド層を堆積し、ダイシングと研磨によ りチャネル導波路の出力端面を形成した。当日は、作製 したデバイスの入力結合特性について報告する。

本研究は科研費 JP16H06415, JP16H06416, JP17H 01063, JP17H05335, JP19H02631, JP19H04543 の助成 および大阪大学フォトニクスセンターの協力を受けた。

S. Yamaguchi *et al.*, ICNS-13, D01.06, (2019).
T. Suhara and H. Nishihara, IEEE J. QE 22, 845 (1986)



Fig. 1 AlN waveguide SHG device with focusing GC and tapered waveguide.



Fig. 2 Dependences of input coupling efficiency η_{in} , output coupling efficiency η_{out} and overlap integral *I* on GC groove depth.



Fig. 3 SEM images of fabricated AlN focusing GC, tapered and channel waveguides.